

This Page Is Inserted by IFW Operations
and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

**As rescanning documents *will not* correct images,
please do not report the images to the
Image Problem Mailbox.**

pc. 8282 ②

⑩ 日本国特許庁(JP)

⑪ 特許出願公開

⑫ 公開特許公報(A)

昭60-150614

⑬ Int. Cl.⁴

識別記号

庁内整理番号

⑭ 公開 昭和60年(1985)8月8日

H 01 F 41/22
C 30 B 23/02

7354-5E
6542-4G

審査請求 未請求 発明の数 1 (全4頁)

⑮ 発明の名称 磁性薄膜の製造方法

⑯ 特 願 昭59-6134

⑰ 出 願 昭59(1984)1月17日

⑱ 発 明 者 五 味 学 市川市菅野6-10-3
⑲ 発 明 者 阿 部 正 紀 東京都大田区西嶺町9-6-705
⑳ 出 願 人 日本板硝子株式会社 大阪市東区道修町4丁目8番地
㉑ 代 理 人 弁理士 土 屋 勝 外1名

明 細 書

1. 発明の名称

磁性薄膜の製造方法

2. 特許請求の範囲

所定の基板上に非晶質の希土類鉄ガーネット薄膜を気相成長法により形成し、上記非晶質の希土類鉄ガーネット薄膜上に保護膜を形成し、次いで熱処理を行うことにより上記非晶質の希土類鉄ガーネット薄膜を結晶化させることを特徴とする磁性薄膜の製造方法。

3. 発明の詳細な説明

本発明は、磁性薄膜の製造方法に関し、より詳細には磁気記録及び光熱磁気記録材料として用いて好適な希土類鉄ガーネット薄膜の製造方法に関する。

近年、希土類鉄ガーネット $R_x(Fe,M)_{1-x}O_{10}$ (R : 希土類元素、 M : Al^{3+} 、 Ga^{3+} 、 Sc^{3+} 、 Ti^{3+} 、 $Co^{3+}+Ti^{3+}$ など) の R の一部を Bi で置換した鉄ガーネット $R_{1-x}Bi_x(Fe,M)_{1-x}O_{10}$ が注目されている。この Bi 置換希土類鉄ガーネットは、

R の一部を Bi で置換することにより、吸収係数 α をあまり大きくすることなくファラデー回転角 θ_F を大きくすることができるという性質を有し、光熱磁気記録材料として一般に優れたものである。

このような性質を有する Bi 置換希土類鉄ガーネットの光熱磁気記録材料としての性能を高めるためには、 Bi 置換量 x を大きくしてファラデー回転角 θ_F を大きくすればよいが、従来の液相エビタキシャル法等の製造方法では Bi 置換量 x が大きい Bi 置換希土類鉄ガーネット薄膜を製造することは困難であった。

本発明者等は、特願昭58-216750号において、固溶限界(十二面体位置の50%)まで Bi が固溶している高濃度 Bi 置換希土類鉄ガーネット単結晶薄膜をスパッタリング法により GGG 基板上にエビタキシャル成長させることのできる磁性薄膜の製造方法を提案した。しかし、この製造方法は、用いることのできる基板が GGG 基板に限定されてしまう点で不利であるため、例えばガラス基板等 非晶質基板上に高濃度 Bi 置換希

土類鉄ガーネット薄膜を形成すること できる製造方法が望まれていた。

このような要求は上記以外の 土類鉄ガーネット薄膜についても従来からあり、種々の試みがなされている。しかしながら、現在までに得られている薄膜はその面と平行な方向に磁化が存在する多結晶の面内磁化膜であり、磁気記録及び光熱磁気記録材料として好ましい垂直磁化膜は未だ得られていない。また特に Bi 置換希土類鉄ガーネット垂直磁化膜を非晶質基板上に形成する試みは全くなされていないのが現状である。

本発明は、上述の問題にかんがみ、良好な垂直磁化特性を有する Bi 置換希土類鉄ガーネット薄膜等の希土類鉄ガーネット薄膜を非晶質基板等の種々の基板上に形成することのできる磁性薄膜の製造方法を提供することを目的とする。

即ち、本発明に係る磁性薄膜の製造方法は、所定の基板上に非晶質の希土類鉄ガーネット薄膜を気相成長法により形成し、上記非晶質の希土類鉄ガーネット薄膜上に保護膜を形成し、次いで熱処

理を行うことにより上記非晶質の 土類鉄ガーネット薄膜を 晶化させるようにしている。このようにすることによって、結晶化のための熱処理による悪影響を防止することができ、極めて良好な垂直磁化特性を有する磁性薄膜を製造することができる。また磁性薄膜を形成すべき基板の材質を種々に選ぶことができるので、製造上極めて好都合である。

以下本発明に係る磁性薄膜の製造方法を(Y, Bi)_{1-x}(Fe, Al)_xO₃ で表される Bi 置換希土類鉄ガーネットの薄膜の製造に適用した一実施例につき図面を参照しながら説明する。なおこの(Y, Bi)_{1-x}(Fe, Al)_xO₃は、イットリウム鉄ガーネット Y_{1-x}Fe_xO₃ (YIG)において、Yの一部をBiで置換すると共にFeの一部をAlで置換したものであり、前者は吸収係数 α をあまり増大することなくファラデー回転角 θ を高め、後者は吸収係数 α を減少させると共に飽和磁化を小さくして垂直磁化膜を得られやすくし、またキュリー温度も下げることが知られている。

まず第1A図に示すように、高周波(RF)スパッタリング装置のステンレス製の電極板(試料台)1の上に石英ガラス基板2を設置すると共に、電極板3に第1のターゲット4を取り付ける。なおこの第1のターゲット4は、組成式 Bi_{1-x}Y_x(Fe_{1-y}Al_y)O₃で表される多結晶状の鉄ガーネットの円盤状の焼結体から成る。

次にスパッタリング装置内を所定の真空度に排気した後、このスパッタリング装置内に Ar と O₂ との混合ガス(Ar:O₂=9:1)を7 Pa 程度まで導入する。真空度が安定した状態で、電極板1と電極板3との間に所定の高周波電圧を印加してグロー放電を開始させる。この放電で生じたAr⁺イオンは第1のターゲット4の表面をスパッタし、このスパッタにより上記第1のターゲット4からBi, Y, Fe, Al, O等の原子が離脱する。これらの離脱した原子は、電極板1を介してヒータ5により例えば440℃に加熱されている石英ガラス基板2上に被 けられ、この石英ガラス基板2上に(Y, Bi)_{1-x}(Fe, Al)_xO₃の非晶質薄膜(以下薄膜

と称する)6が形成される。なおスパッタに用いる電力を110Wとし、またスパッタ時間を2時間30分とした場合、得られた薄膜6の厚さは0.8 μ mであった。

次に第1B図に示すように、電極板1に取り付けられている第1のターゲット4をSiO₂から成る第2のターゲット7と交換した後、再びスパッタリング装置内を所定の真空度に排気し、次にこのスパッタリング装置内に Ar と O₂ との混合ガス(Ar:O₂=9:1)を7 Pa 程度まで導入する。真空度が安定した状態で、電極板1と電極板3との間に所定の高周波電圧を印加してグロー放電を開始させる。この結果、薄膜6上にSiO₂膜8が形成される。なおこの際、石英ガラス基板2は室温に保持する。またスパッタに用いる電力を200Wとし、またスパッタ時間を30分とした場合、得られたSiO₂膜8の厚さは0.5 μ mであった。

次に上述のように形成された石英ガラス基板2、薄膜6及びSiO₂膜8から成る三層 造の試料を

空气中において700℃、3時間の条件で熱処理して磁性薄膜の製造を終了する。

なお本実施例においては、SiO₂膜8から成る保護膜の存在によって上記熱処理中に薄膜6中に含有されているBi等の薄膜構成原子が外方拡散（アウトディフュージョン）すること及び膜面の荒れを防止することができると共に、薄膜6の結晶粒の成長を抑えることができる。

上述の実施例により製造された薄膜6の結晶性をX線回折により調べたところ、優勢方位のない多結晶であることが判明した。しかし、光学顕微鏡による観察の結果、多結晶であるにもかかわらず薄膜6は層状構造及びバブル状の磁区構造を有し、また次のような優れた特性を有する極めて良好な垂直磁化膜であることが測定によって明らかにされた。

即ち、第2図に示すように、膜面に垂直な方向の磁界Hに対する薄膜6のファラデー回転角 θ 、のヒステリシス特性を測定したところ、角形性が良好なループが得られ、磁気トルク測定から垂直

磁化膜であることが判明した。またファラデー回転角 θ は約1.5°と極めて大きく、また保磁力H_cも約200 Oeと十分に大きい。このように、薄膜6は磁気記録材料として極めて好ましい性質を有していることがわかる。なお第2図に示すような優れた特性を有する垂直磁化膜が得られることから、薄膜6中にはより大きな垂直磁気異方性を賦与するBiが固溶限界程度まで固溶していることが推定される。なお第2図において、ファラデー回転角 θ 、測定用の光源としては、He-Neレーザー（波長6328Å）を用いた。また測定は、上記薄膜6に光を透過させて行った。

上述の実施例においては、薄膜6を形成すべき基板として石英ガラス基板2を用いたが他の種類のガラス基板等の非晶質基板を用いてもよいことは勿論、例えば金属、半導体、絶縁体等の結晶性基板を用いてもよい。また保護膜としては、例えば700℃程度の高温で薄膜6と反応しなければSiO₂膜8以外の膜でもよく、例えばZnO、TiO₂、CoO、等の酸化物、Si、N、等の窒化物、Ba、Pb、

Ca、F、等のフッ化物等の膜を用いてもよい。なお保護膜の膜厚は500Å以上であるのが好ましい。

また上述の実施例においては、磁性薄膜及び保護膜を形成するのにスパッタ法を用いたが、例えば蒸着法、CVD法、イオンブレーティング法等の他の気相成長法を用いてもよい。なお保護膜（SiO₂膜、TiO₂膜等）はいわゆる熱分解焼付法によって形成することも可能である。ここで非晶質磁性薄膜の膜厚は5μm以下であるのが好ましい。

また非晶質磁性薄膜は希土類鉄ガーネットであれば磁性薄膜となるが、十二面体位置の20%以上がBiに置換されたBi置換希土類鉄ガーネットであれば磁気異方性が増し好ましい。

さらに上述の実施例においては、熱処理条件を700℃、3時間としたが、これに限定されるものではなく必要に応じて変更することができる。しかし、熱処理温度が低すぎると結晶化の程度が小さいので、500℃以上の温度で熱処理するのが好ましい。また薄膜6を形成するとき基

板温度も実施例の温度に限定されるものではなく形成される薄膜6が非晶質であれば他の温度でもよいが、500℃以下であるのが好ましい。

なお上述の実施例においては、非晶質の希土類鉄ガーネット薄膜の形成にスパッタ法を用い、その第1のターゲットの材料として組成式Bi_xY_{1-x}Fe_{2-x}Al_{1+x}O₁₂で表される多結晶状の鉄ガーネットを用いたが、ターゲット組成はこれに限定されるものではなく、例えば上述の組成式に含まれる元素をそれぞれ含む混合物であってもよい。より一般的には、(Bi_{1-x}O_x)₂(R₂O₃)₂(Fe_{2-x}O_{3-x})(M₂O₃)₂で表されるような少なくともBi原子、Fe原子及び希土類原子を含む酸化物から成る材料を用いることができる。ここで、0 < x ≤ 3/2、0 < y ≤ 3/2、0 < z < 5/2、0 ≤ u ≤ 5/2である。またRはY、Sm等の希土類元素であり、MはAl³⁺、Ga³⁺、Sc³⁺、Ti³⁺、(Co²⁺+Ti³⁺)等である。

以上述べたように、本発明に係る磁性薄膜の製造方法によれば、得られる希土類鉄ガーネット薄

膜は所定の基板上に形成された非晶質の希土類鉄ガーネット薄膜を熱処理により結晶化したものであり、またこの際この結晶化のための熱処理による悪影響を上記希土類鉄ガーネット薄膜上に形成した保護膜により防止することができるので、極めて良好な垂直磁化特性を有する磁性薄膜を製造することができる。また磁性薄膜を形成すべき基板の材質を種々に選ぶことができるので、製造上極めて好都合である。

4. 図面の簡単な説明

第1A図及び第1B図は本発明に係る磁性薄膜の製造方法の一実施例をその実施に用いた高周波スパッタリング装置と共に工程順に示す断面図、第2図は本発明に係る磁性薄膜の製造方法の一実施例により製造された $(Y,Bi)_{0.8}(Fe,Al)_{0.2}$ 薄膜のヒステリシス特性を示すグラフである。

なお図面に用いた符号において、

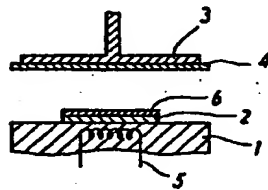
- 1 電極板(試料台)
- 2 石英ガラス基板
- 3 電極板

- 4 第1のターゲット
- 5 ヒータ
- 6 $(Y,Bi)_{0.8}(Fe,Al)_{0.2}$ 薄膜
- 7 第2のターゲット
- 8 SiO_2 膜

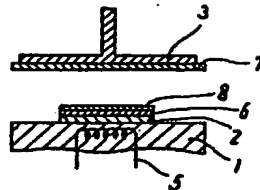
である。

代理人 土屋 勝
常包 芳 男

第1A図



第1B図



第2図

